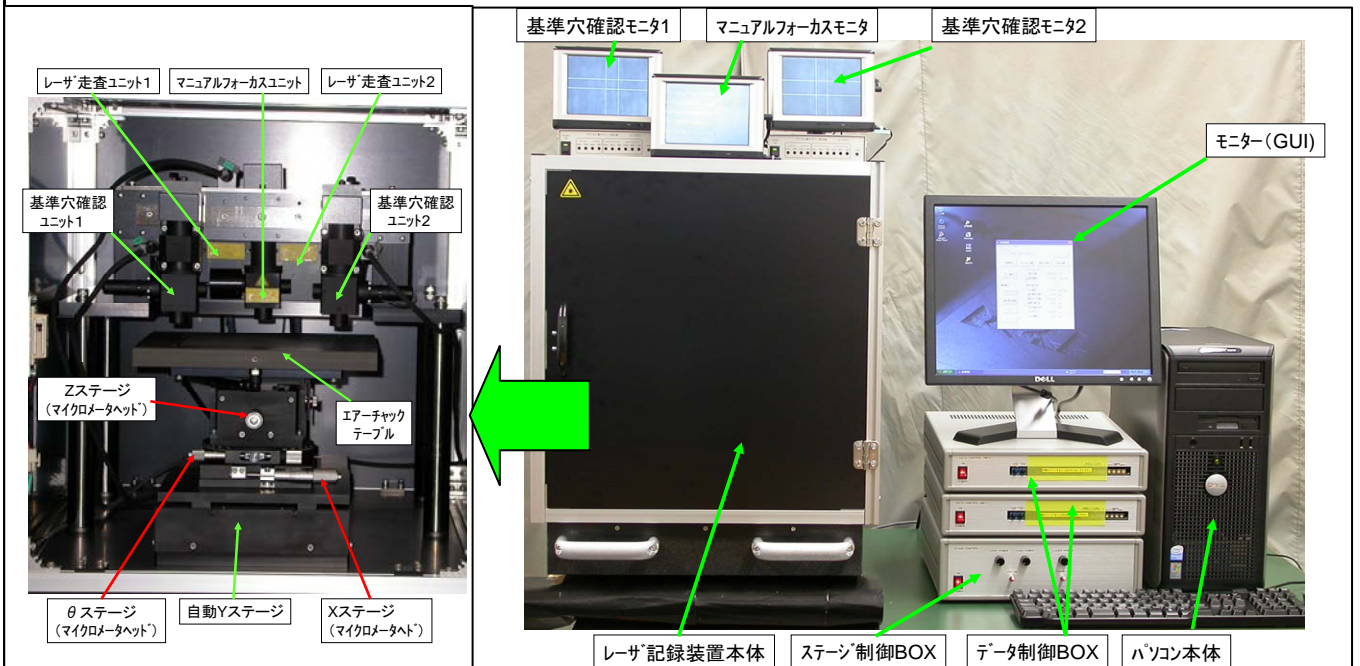




マルチポリゴンレーザ直描装置

ポリゴン走査ユニットを複数台(マルチ)連結することで、 $\phi 10 \mu\text{m}$ (FWHM)のビーム径を維持したままワイド露光にも対応

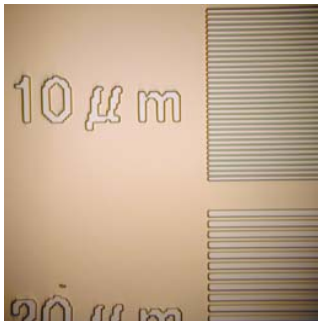


レーザ記録装置内部

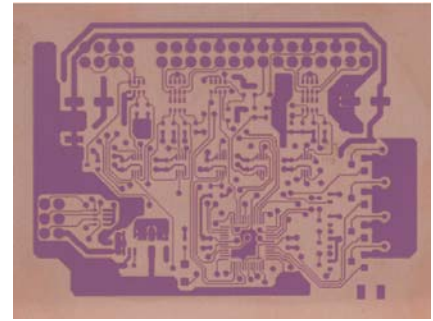
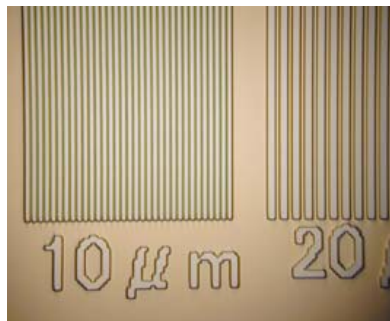
システム全体構成

[標準基本仕様: 走査ユニット2連結の場合]

項目	基本仕様	備考
有効露光Jobサイズ	150mm(走査幅)×150mm(ステージ送り)	
走査ビーム径(FWHM)	$\phi 10 \mu\text{m}$	レーザが405nmの場合
レーザタイプ	半導体レーザ(405nm, 650nm, 780nm, 830nm)	固体レーザ: 355nm, 488nm, 532nmも可
データ解像度	2,540dpi	
データフォーマット	BMP	
フォーカスユニット(マニュアル操作)	フォーカス光学系, モニタ, Z軸ステージ	
[選択オプション]		
データ解像度	5,080dpi	有効Jobサイズは150mm×80mm
繰り返し露光機能	ステージ送り方向にJobを任意回数露光	要求仕様に合わせてY軸ステージ長を決定
基準穴位置調整機能	基準穴確認光学系, モニタ, X軸θ軸ステージ	
エアーチャックテーブル	セラミックステーブル or アルミテーブル	



露光サンプル[液体ホジレジスト]



露光サンプル[ネグドライフィルム on 銅貼り基板]

(注)このカタログは予告無く変更することがあります。

ご質問、特注仕様などのお問い合わせはこちらまで

株式会社オプセル <http://www.opcell.co.jp> E-mail: support@opcell.co.jp

〒333-0844 埼玉県川口市上青木3-12-18 SAITEC752 TEL:048-260-3308 FAX:048-260-3309